

【 支援装置料金表 < 微細加工 > 】

北海道大学 ナノテクノロジー連携研究推進室 < <http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris/nanoplat/> >

設備	型式	初回講習料 (円)	利用料 (円/1h) (大学・公的機関)	利用料 (円/1h) (一般)	技術代行料 (円/1h) (大学・公的機関)	技術代行料 (円/1h) (一般)
超高精度電子ビーム描画装置 125kV	ELS-F125-U	28,000	2,500	7,200	6,000	10,700
超高精度電子ビーム描画装置 100kV	ELS-7000HM	28,000	1,600	6,200	5,100	9,700
マスクアライナ	MA-20	3,500	400	1,100	3,900	4,600
レーザー描画装置	DDB-201-200	14,000	400	400	3,900	3,900
真空蒸着装置	ED-1500R	7,000	500	1,000	4,000	4,500
プラズマCVD装置	PD-220ESN	7,000	1,200	4,000	4,700	7,500
液体ソースプラズマCVD装置	PD-10C1	21,000	300	400	3,800	3,900
ヘリコンスパッタリング装置	MPS-4000C1/HC1	10,500	2,000	3,200	5,500	6,700
イオンビームスパッタ装置	IBS-6000S	7,000	700	1,200	4,200	4,700
原子層堆積装置	SUNALE-R	14,000	1,500	1,500	5,000	5,000
ICPドライエッチング装置	SPM-200	7,000	1,300	3,600	4,800	7,100
反応性イオンエッチング装置	RIE-101iPH	10,500	1,600	3,700	5,100	7,200
反応性イオンエッチング装置	RIE-10NRV	7,000	900	2,700	4,400	6,200
ドライエッチング装置	NLD-500	10,500	700	1,300	4,200	4,800
イオンミリング装置	IBE-6000S	7,000	600	900	4,100	4,400
電界放射型走査型電子顕微鏡	JSM-6700FT	84,000	800	900	4,300	4,400
電子ビーム描画装置	ELS-3700	10,500	1,100	1,900	4,600	5,400
電子線描画装置	ELS-7300	28,000	1,600	4,900	5,100	8,400
両面マスクアライナ	MA-6	28,000	600	2,600	4,100	6,100
ECR加工装置	EIS-200ER	17,500	900	1,400	4,400	4,900
ICP加工装置	EIS-700S	10,500	900	900	4,400	4,400
超高真空5源ヘリコンスパッタ	AvO28	10,500	1,100	2,200	4,600	5,700
ALD製膜装置	Savannah 100	10,500	1,300	2,600	4,800	6,100
スパッタ装置	SPF-210H	10,500	200	400	3,700	3,900
EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	EBX-8C	7,000	2,000	2,300	5,500	5,800
EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	AV096-000	7,000	1,200	2,200	4,700	5,700
FIB加工装置	EIP-3300	17,500	1,200	1,700	4,700	5,200
ナノカーボン成長炉	Easy tube system	17,500	300	300	3,800	3,800
エリブソメーター	M-500S	3,500	200	700	3,700	4,200
超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置	ELS-F130HM	28,000	5,500	25,500	9,000	29,000
半導体薄膜堆積装置	PAC-LMBE	14,000	1,500	4,900	5,000	8,400
電子線3次元粗さ解析装置	ERA-8000FE	14,000	1,100	1,100	4,600	4,600
コンパクトスパッタ装置	ACS-4000-C3-HS	10,500	1,100	2,900	4,600	6,400
ICP高密度プラズマエッチング装置	RIE-101iHS	7,000	1,600	5,400	5,100	8,900
技術相談料 (一時間当たり)					3500	

■初回講習料+利用料/1h (または技術代行料/1h) ×時間

■料金の納付: 指定預金口座に振り込み